

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局



(43)国際公開日
2005年9月1日 (01.09.2005)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2005/080459 A1

(51)国際特許分類:
77/442, C09J 151/08, 7/02

C08F 283/12, C08G

(72)発明者; および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 公文 健人
(KUMON, Taketo) [JP/JP]; 〒2360055 神奈川県横
浜市金沢区片吹1-3-1 Kanagawa (JP). 影山 俊文
(KAGEYAMA, Toshifumi) [JP/JP]; 〒2380000 神奈川
県横須賀市グリーンハイツ5-2-4 O5 Kanagawa
(JP). 木村 敦子 (KIMURA, Atsuko) [JP/JP]; 〒1730016
東京都板橋区中板橋6-10 中板橋寮1-101
Tokyo (JP). 杉崎 俊夫 (SUGIZAKI, Toshio) [JP/JP]; 〒
2360011 神奈川県横浜市金沢区長浜2-23-20
Kanagawa (JP). 守谷 治 (MORIYA, Osamu) [JP/JP]; 〒
2330013 神奈川県横浜市港南区丸山台2-13-11
Kanagawa (JP).

(21)国際出願番号:

PCT/JP2004/013838

(22)国際出願日: 2004年9月22日 (22.09.2004)

(25)国際出願の言語: 日本語

(26)国際公開の言語: 日本語

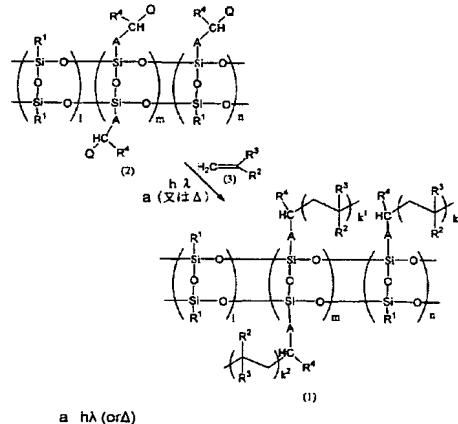
(30)優先権データ:
特願2004-049894 2004年2月25日 (25.02.2004) JP

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): リン
テック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP];
〒1730001 東京都板橋区本町23-23 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING POLYSILSESQUIOXANE GRAFT POLYMER, PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE, AND PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE SHEET

(54)発明の名称: ポリシリセスキオキサングラフト重合体の製造方法、粘着剤および粘着シート



a hλ (or Δ)

WO 2005/080459 A1

(57) Abstract: A process for producing a polysilsesquioxane graft polymer (1), characterized by irradiating a mixture comprising a polysilsesquioxane compound (2) and a vinyl compound (3) with an ionizing radiation or heating the mixture; a polysilsesquioxane compound having an infirter group incorporated therein; and a pressure-sensitive adhesive and a pressure-sensitive adhesive sheet each comprising the polymer. The polysilsesquioxane graft copolymer produced by the process can be a pressure-sensitive adhesive combining excellent heat resistance with excellent cohesive force. (In the formulae, A represents a connecting group; R¹ represents an optionally substituted hydrocarbon group; R² represents hydrogen, etc.; R³ represents a polar group, etc.; R⁴ represents hydrogen, etc.; k₁ to k₃ each is any desired natural number; l to n each is 0 or any desired natural number (the case where m=n=0 is excluded); and Q represents an infirter group.) (2) (3) (1) a h λ (or Δ)

(57) 要約: 本発明は、ポリシリセスキオキサン化合物(2)と、ビニル化合物(3)とを含む混合物に電離放射線を照射、または加熱することを特徴とする、ポリシリセスキオキサングラフト重合体(1)の製造方法、イニシアータ基が導入されたポリシリセスキオキサン化合物、並びに該重合体を用いる粘着剤及び粘着

[続葉有]



- (74) 代理人: 大石 治仁 (OHISHI, Haruhito); 〒1010047 東京都千代田区内神田 3 丁目 6 番 1 号 さんしんヒロセビル 5 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ヨーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

シートである。本発明によれば、優れた耐熱性と凝集力を兼ね備えた粘着剤となり得るポリシリセスキオキサングラフト重合体の製造方法等が提供される。(式中、Aは連結基を、R¹は置換基を有していてもよい炭化水素基を、R²は水素原子等を、R³は極性基等を、R⁴は水素原子等を、k 1～3は任意の自然数を、l～nは0又は任意の自然数(m=n=0の場合を除く)を、Qはイニファータ基を表す。)